```
(Item 2 from file: 351)
1/5/2
DIALOG(R) File 351: Derwent WPI
(c) 2006 The Thomson Corporation. All rts. reserv.
0010667126 - Drawing available
WPI ACC NO: 2001-275769/
XRAM Acc No: C2001-112958
New 4-tert-butoxy-4'-cyanobiphenyl useful for liquid crystals and
monomer of side chain-type liquid crystal polymers
Patent Assignee: TOSOH CORP (TOYJ)
Inventor: EGUCHI H; HARA T
                           1 countries)
Patent Family (1 patents,
                               Application
Patent
                                              Kind
                                                     Date
                Kind
                       Date
                               Number
Number
Update
                                                A 19991217
                     20001212 JP 1999359389
JP 2000344727
200129 B
Priority Applications (no., kind, date): JP 199985864
19990329
Patent Details
                              Dwg
                                   Filing Notes
Number
              Kind Lan
                           Pq
JP 2000344727
              A
                     JΑ
                           12
  Alerting Abstract JP A
  NOVELTY - 4-tertiary butoxy-4'-cyanobiphenyl (I) is new.
  DESCRIPTION - 4-tertiary butoxy-4'-cyanobiphenyl of formula (I)
is new.
http://imagesrv.dialog.com/imanager/getimage?ref=I70649400638911da
99f600008361346f&f=351&type=PNG
  INDEPENDENT CLAIMS are also included for
  (1) preparation of (I) and
  (2) preparation of 4-hydroxy-4'-cyanobiphenyl by de-
isobutenation of (I)
in the presence of an acid catalyst.
  USE - (I) is used as an intermediate for liquid crystals and as
a material for monomer of side chain-type liquid crystal polymers.
  ADVANTAGE - High purity (I) is prepared efficiently and
economically.
Title Terms/Index Terms/Additional Words: NEW; TERT; BUTOXY;
USEFUL; LIQUID; CRYSTAL; MONOMER; SIDE; CHAIN; TYPE; POLYMER
Class Codes
International Classification (Main): C07C-255/54
 (Additional/Secondary): B01J-023/44, B01J-031/22, B01J-031/24,
            , C07B-061/00, C07C-253/30
C07B-037/04
File Segment: CPI
DWPI Class: A41; E14; L03
Manual Codes (CPI/A-M): A01-E06; A01-E13; E10-A15E; L03-D01; N02-
  N02-F01; N02-F02; N04; N05-E01; N05-E03
```

BEST AVAILABLE COPY

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-344727 (P2000-344727A)

(43)公開日 平成12年12月12日(2000.12.12)

(51) Int.Cl.'	識別記号		F I			テーマコード(参考)		
C 0 7 C 255/54			C 0	7 C 255/54			4H006	
B01J 23/44			B 0	1 J 23/44		x	4H039	
31/22				31/22		· X		
31/24			•	31/24		x	.•	
C 0 7 C 253/30			C 0 '	7 C 253/30				
		審查請求	未請求	請求項の数5	OL	(全 12 頁).	最終頁に続く	

(21)出願番号 特願平11-359389

(22)出顧日 平成11年12月17日(1999.12.17)

(31) 優先権主張番号 特願平11-85864

(32) 優先日 平成11年3月29日(1999.3.29)

(33)優先権主張国 日本(JP)

(71)出願人 000003300

東ソー株式会社

山口県新南陽市開成町4560番地

(72) 発明者 原 大治

山口県新南陽市土井2丁目15番4-207

(72)発明者 江口 久雄

山口県新南陽市中畷町1番27

Fターム(参考) 4H006 AA01 AA02 AB64 AC13 AC22

AC23 BA02 BA21 BA25 BA29 BA37 BA44 BA45 BA46 BA48 BA53 BB11 BB15 BB19 BB22 BB24 BB61 BC34 BP30

4H039 CA19 CG20

(54) 【発明の名称】 4-ターシャリープトキシー4'-シアノピフェニル及びその製造方法、並びに4-ヒドロキシ -4'-シアノピフェニルの製造方法

(57)【要約】

{(k,2)

【課題】 4-ヒドロキシー4'ーシアノピフェニルへの変換が極めて容易であり、また、液晶等の電子材料、側鎖型液晶ポリマー等の機能性高分子用モノマー原料として極めて有用な化合物及びその製造方法を提供する。

【解決手段】 下記一般式(2)

$$\begin{pmatrix}
H_3C \\
H_3C
\end{pmatrix} C - O - MX_{n-m}$$
(2)

(式中、Yは、塩素原子、臭素原子、沃素原子又はトリフレートを表す。)で示される4ー置換ベンゾニトリル化合物とを、Pd触媒、Ni触媒又はPd-Niバイメタル触媒の存在下、クロスカップリング反応させて4ーターシャリーブトキシー4'-シアノビフェニルを製造する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記構造式(1)

$$\begin{array}{c}
H_3C \\
H_3C - C - O \\
H_3C
\end{array}$$
CN (1)

で示される4-ターシャリープトキシ-4'-シアノビ フェニル。

【請求項2】 下記一般式(2)

$$\begin{pmatrix}
H_3C \\
H_3C \\
C \\
C \\
C
\end{pmatrix}$$

$$MX_{n-m} \qquad (2)$$

(式中、Yは塩素原子、臭素原子、沃素原子又はトリフレートを表す。)で示される4-置換ベンゾニトリル化合物とを、Pd触媒、Ni触媒又はPd-Niバイメタル触媒の存在下、クロスカップリング反応させることを特徴とする請求項1に記載の4-ターシャリーブトキシー4′-シアノピフェニルの製造方法。

【請求項3】 下記一般式(8)

【化4】

(式中、Yは塩素原子、臭素原子又は沃素原子を表す。) で示されるマグネシウム化合物、又は下記構造式 (9)

で示されるリチウム化合物を、亜鉛化合物、ホウ素化合物、ケイ素化合物及び錫化合物からなる群より選ばれる少なくとも一種と反応させて下記一般式(2)

【化6】

$$\begin{pmatrix}
H_3C \\
H_3C - C - O
\end{pmatrix}$$

$$MX_{n-m} \qquad (2)$$

(式中、MはZn、B、Si YはSnであり、XはY1 ゲン、Yルコキシ基、ヒドロキシル基Yは炭化水素基を表す。Mは $1 \le M \le N$ なる数であり、N はMの価数に対応した $2 \sim 4$ の数を表す。)で示される $4 - 9 - 2 \sim 10$ ープトキシフェニル金属化合物を得る工程、Y0 び該 $4 - 9 - 2 \sim 10$ ープトキシフェニル金属化合物と下記一般式(3)

【化7]

(式中、Yは塩素原子、臭素原子、沃素原子又はトリフレートを表す。)で示される4ー置換ベンゾニトリル化合物とを、Pd触媒、Ni触媒又はPd-Niバイメタル触媒の存在下、クロスカップリング反応させる工程からなることを特徴とする請求項1に記載の4ーターシャリーブトキシー4'-シアノピフェニルの製造方法。

【請求項4】 4-ターシャリープトキシフェニルホウ素化合物を<math>-30 ℃以上40 ℃以下の温度で調製することを特徴とする請求項3に記載の製造方法。

【請求項5】 請求項1に記載の4-ターシャリープトキシ-4'-シアノビフェニルを、酸触媒下、脱イソプテン反応させることを特徴とする4-ヒドロキシ-4'-シアノビフェニルの製造方法。

【発明の詳細な説明】

30 . [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶等の電子材料、側鎖型液晶ポリマー等の機能性高分子用モノマーの原料となる4-ターシャリーブトキシー4'ーシアノビフェニル及びその製造方法、並びにそれを用いた4-ヒドロキシー4'ーシアノビフェニルの製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】4-アルコキシ-4'-シアノビフェニル及び4-ヒドロキシ-4'-シアノビフェニルの合成方法としては、以下のような方法が知られている。

【0003】i)特開平1-39474号公報には、出発原料である4-酢酸ピフェニルを、プロモ化し、4-プロモ-4'-酢酸ピフェニルを得て、これを水酸化カリウムにより、4-プロモ-4'-オキシピフェニルカリウム塩として、沃化アルキルを反応させるか又は加水分解した後、シアン化銅で処理することで、4-アルコキシ-4'-シアノピフェニルを得る方法が記載されている。

[0004] また、近年、有機金属化合物と有機ハライドを遷移金属触媒共存下、クロスカップリング反応によ

り合成する方法が数多く提案されている。例えば、

ii)ドイツ特許第19607135号明細書(1990)に記載の方法では、p-メトキシマグネシウムブロミドとp-ブロモベンゾニトリルを酢酸パラジウム/トリフェニルホスフィン系触媒下、クロスカップリング反応させ、4-メトキシー4'-シアノビフェニルを得ている。しかしながら、この方法では、有機マグネシウム化合物が、シアノ基を求核攻撃するため、4-ブロモー4'-メトキシベンゾフェノニウムの副生が避けられない。有機マグネシウムを用いた方法で、本副生成物の生の成を抑えた方法としては、例えば、

i i i) Журнал орбанцуескоц х uмии. 31, 11 (1995) では、p-メトキシマグネシウムブロミドとp-ジブロモベンゼンをパラジウムビス (ジフェニルホスフィノ) フェロセン触媒下、クロスカップリング反応させ、4-ブロモ-4'-メトキシービフェニルを得、これをシアン化銅により、シアノ化する方法が提案されている。

【0005】一方、有機マグネシウム化合物の如く、シアノ基を求核攻撃しない様な有機金属化合物を用い、pーハロゲン化ベンゾニトリルとのクロスカップリング反応を行うことが提案されている。例えば、

iv) J. Organomet. Chem., 390, 389 (1990) の記載の方法において、pーメトキシフェニル亜鉛クロリドとpープロモベンゾニトリルをテトラ(トリフェニルホスフィン) パラジウム触媒存在下のクロスカップリング反応により、ほぼ定量的に目的物である4-メトキシー4'ーシアノビフェニルを得ている。また、

v) Tetrahedron Lett., 38, 34 47 (1997) に記載の方法では、p-メトキシフェニルボレートとp-シアノトリフレートをパラジウムビス (ジフェニルホスフィノ) フェロセン触媒下にクロスカップリング反応させ、4-メトキシー4'-シアノビフェニルを高収率で得ている。さらに、

vi)特開平6-239766号公報に記載の方法では、エチル(ジクロロ) (p-メトシキフェニル) シランとp-ブロモベンゾニトリルを酢酸パラジウム/トリーo-トリルホスフィン系触媒下のクロスカップリング反応により、4-メトキシ-4'-シアノビフェニルを 40得ている。

【0006】4-メトキシー4'-シアノビフェニルは、脱メチル化反応により、4-ヒドロキシー4'-シアノビフェニルに誘導することができるが、この脱メチル化反応は、酢酸中で臭化水素酸で処理する等、操作及び後処理を考慮すれば、簡便な方法ではない。4-tert.-ブトキシピフェニル誘導体としては、

v i i) 特開平4-173756号公報では、4-tert. -プトキシー4'-フルオロビフェニルの製造方法が提案されているが、p-tert. -プトキシフェ 50

ニルマグネシウムハライドとpーハロゲン化フルオロベンゼン、又はpーフルオロフェニルマグネシウムハライドとpーtert.ープトキシハロゲン化ベンゼンをバラジウムホスフィン触媒下にクロスカップリング反応させており、上述の如く、シアノ化体合成には、適用できないものである。

【0007】更に、4-シアノピフェニル誘導体としては

viii)特開平6-49080号方法では、表示用液晶組成物として、シアノビフェニルシロキサンを提案しており、その実施例において、有機マグネシウム化合物を経由した合成処方を採用している。この際も、有機マグネシウムによるp-プロモベンゾニトリルのシアノ基の求核攻撃する可能性があり、シアノビフェニル誘導体合成には、適当ではない。

[8000]

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記の課題に 鑑みてなされたものであり、その目的は、従来技術の問題を解決すること、すなわち、4ーヒドロキシー4'ーシアノビフェニルへの変換が極めて容易であり、また、 液晶等の電子材料、側鎖型液晶ポリマー等の機能性高分 子用モノマー原料として極めて有用な化合物及びその製造方法を提供することである。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の課題を解決するために鋭意検討を重ねた結果、4-ターシャリープトキシー4'ーシアノビフェニルが安定であり、定量的合成が可能なこと、殊にクロスカップリング反応を用いた方法により容易に合成できること、更に、酸触媒下、容易に4-ヒドロキシー4'ーシアノビフェニルに変換できることを見出し、本発明を完成させるに至った。

【0010】すなわち、本発明は、下記構造式(1) 【0011】

【0012】で示される4-ターシャリーブトキシー4'-シアノピフェニル及びその製造方法、並びにそれを用いた4-ヒドロキシー4'-シアノピフェニルの製造方法である。

【0013】本発明の4-ターシャリーブトキシー4'-シアノビフェニルは、4-ヒドロキシー4'-シアノビフェニルへの変換が極めて容易であり、また、液晶等の電子材料、側鎖型液晶ポリマー等の機能性高分子用モノマー原料として極めて有用である。

【0014】以下に本発明をさらに詳細に説明する本発明においては、下記一般式(2)

[0015]

$$\begin{pmatrix}
H_3C \\
H_3C \\
C \\
C \\
C
\end{pmatrix}$$

$$MX_{n-m}$$
(2)

【0016】(式中、Mは2n、B、Si 又はSnであり、XはNロゲン、ヒドロキシル基、アルコキシ基又は炭化水素基を表す。mは $1 \le m \le n$ なる数であり、nはMの価数に対応した $2 \sim 4$ の数を表す。)で示される4 - 9 - シャリーブトキシフェニル金属化合物と下記一般式(3)

【0018】(式中、Yは塩素原子、臭素原子、沃素原子又はトリフレートを表す。)で示される4ー置換ペンパニトリル化合物とを、Pd触媒、Ni触媒又はPdーNiバイメタル触媒の存在下、クロスカップリング反応させるにより、上記構造式(1)に示される4ーターシャリープトキシー4'ーシアノビフェニルを得る。

【0019】本発明の4-ターシャリープトキシー4'-シアノビフェニルは、例えば、4-ヒドロキシー4'-シアノビフェニルを硫酸等の酸触媒下にイソプテンにより、ヒドロキシル基をイソプチル化することによっても合成することはできる。しかしながら、上記文献i)の如き合成方法で得られた4-ヒドロキシー4'-シアノビフェニルは、不純物として位置異性体を含む場合があり、また、フェノール構造のイソブテンを用いたイソブチル化反応は、平衡反応であり、定量的な反応とならず、高純度品を得るには不適当な場合がある。

【0020】したがって、上記構造式(1)を有する高純度な4-ターシャリープトキシー4'ーシアノビフェニルを合成するためには、上記一般式(2)で示される4-ターシャリープトキシフェニル基を有するホウ素化合物、亜鉛化合物、ケイ素化合物及び錫化合物からなる群から選ばれる少なくとも一種と、上記一般式(3)で示される4-置換ベンゾニトリル化合物とを、Pd触媒、Ni触媒又はPd-Niバイメタル触媒の存在下、クロスカップリング反応させる本発明の方法が好適に用いられる。

【0021】本発明の方法において使用される上記一般式(2)で示される4-ターシャリープトキシフェニル 金属化合物のうち、ホウ素化合物としては、例えば、下記一般式(4)

[0022]

$$\begin{pmatrix}
H_3C \\
H_3C - C - O - \downarrow \\
H_3C
\end{pmatrix}_{p} BX^{1}_{3-p} \qquad (4)$$

【0023】(式中、X¹は、ヒドロキシル基、アルコ キシ基又は炭化水素基を示し、pは3以下の正数を表 す。)で示される化合物を挙げることができる。具体的 には、例えば、トリ(4-ターシャリープトキシフェニ ル) ホウ素、4-ターシャリープトキシフェニルジヒド ロキシホウ素、ジ(4-ターシャリーブトキシフェニ ル) ヒドロキシホウ素、4-ターシャリープトキシフェ ニルジメトキシホウ素、ジ(4-ターシャリーブトキシ フェニル) メトキシホウ素、4-ターシャリープトキシ フェニルジエトキシホウ素、ジ(4-ターシャリープト キシフェニル) エトキシホウ素、4-ターシャリーブト キシフェニルジ(n-プロポキシ)ホウ素、ジ(4-タ ーシャリープトキシフェニル) (n - プロポキシ) ホウ 素、4-ターシャリーブトキシフェニルジ (i-プロポ キシ) ホウ素、ジ(4-ターシャリープトキシフェニ ル) (i-プロポキシ) ホウ素、4-ターシャリーブト キシフェニルジ (n-プトキシ) ホウ素、ジ (4-ター) シャリーブトキシフェニル) (n-ブトキシ) ホウ素、 4-ターシャリーブトキシフェニルジ (i-ブトキシ) ホウ素、ジ(4-ターシャリープトキシフェニル) (i - ブトキシ) ホウ素、4-ターシャリープトキシフェニ ルジ (sec-ブトキシ) ホウ素、ジ (4-ターシャリ ーブトキシフェニル) (secーブトキシ) ホウ素、4 -ターシャリープトキシフェニルジ(tert-プトキ シ) ホウ素、ジ(4-ターシャリープトキシフェニル) (tertープトキシ) ホウ素、4-ターシャリープト キシフェニル (ベンゼンジオキシ) ホウ素、4-ターシ ャリープトキシフェニル(プロパンジオキシ)ホウ素、 4-ターシャリープトキシフェニルジエチルホウ素、ジ (4-ターシャリープトキシフェニル) エチルホウ素、 4-ターシャリープトキシフェニル(9-ポラビシクロ [3.3.1] ノナリル) ホウ素等を挙げることができ

【0024】亜鉛化合物としては、例えば、下記一般式(5)

[0025] (化12] / H₃C

$$\begin{pmatrix}
H_3C \\
H_3C - C - O - C \\
H_3C
\end{pmatrix}_{q} Z_n X^2_{2-q}$$
(5)

【0026】(式中、 X^2 はハロゲン又は炭化水素基を表し、qは2以下の正数を表す。)で示される化合物を挙げることができる。具体的には、例えば、ジ (4-9-2) ーブトキシフェニル)塩化亜鉛、 (4-9-2) ーブトキシフェニル)塩化亜鉛、 (4-9-2) ーブ

トキシフェニル)臭化亜鉛、(4-タ-シャリープトキシフェニル)沃化亜鉛、4-ターシャリープトキシフェニル(メチル)亜鉛、4-ターシャリープトキシフェニル(x チル)亜鉛、4-ターシャリープトキシフェニル(<math>x チル)亜鉛、4-ターシャリープトキシフェニル(<math>x ナープロピル)亜鉛、4-ターシャリープトキシフェニル(<math>x ナープロピル)亜鉛、x カーターシャリープトキシフェニル(x カープチル)亜鉛、x カーターシャリープトキシフェニル(x カープチル)亜鉛、x カーターシャリープトキシフェニル(x カープチル)亜鉛、x カーターシャリープトキシフェニル(x カープチル)亜鉛、x カーダーシャリープトキシフェニル(x カーブチル)亜鉛等を挙げることができる。

[0027]ケイ素化合物としては、下記一般式(6) [0028]

【化13】

$$\begin{pmatrix}
 H_3C \\
 H_3C - C - O
\end{pmatrix} = SiX^3_{4-r}$$
(6)

【0029】(式中、X3はハロゲン又は炭化水素基を 示し、rは4以下の正数を表す。) で示される化合物を 20 挙げることができる。具体的には、例えば、4-ターシ ャリープトキシフェニル(エチル)ジクロロシラン、4 -ターシャリーブトキシフェニル(ジエチル)クロロシ ラン、4-ターシャリーブトキシフェニルトリエチルシ ラン、ジ(4-ターシャリープトキシフェニル)(エチ ル) クロロシラン、ジ(4-ターシャリープトキシフェ ニル) ジエチルシラン、4 - ターシャリープトキシフェ ニル(メチル)ジクロロシラン、4-ターシャリープト キシフェニル (ジメチル) クロロシラン、4-ターシャ リーブトキシフェニルトリメチルシラン、ジ(4-ター 30 シャリーブトキシフェニル)(メチル)クロロシラン、 ジ(4-ターシャリーブトキシフェニル)ジメチルシラ ン、4-ターシャリープトキシフェニルトリクロロシラ ン、ジ(4 - ターシャリープトキシフェニル)ジクロロ シラン等を挙げることができる。

[0030] 錫化合物としては、例えば、下記一般式(7)

[0031]

【化14】

$$\begin{pmatrix}
H_3C \\
H_3C - C - O
\end{pmatrix} = SnX^4_{4-s} \qquad (7)$$

【0032】(式中、X⁴は炭化水素基を示し、rは4以下の正数を表す。)で示される化合物を挙げることができる。具体的には、例えば、4-ターシャリーブトキシフェニルトリメチルスズ、ジ(4-ターシャリーブトキシフェニル)ジメチルスズ、トリ(4-ターシャリーブトキシフェニル)メチルスズ、4-ターシャリーブトキシフェニルトリエチルスズ、ジ(4-ターシャリーブ

トキシフェニル) ジエチルスズ、トリ (4-ターシャリ ーブトキシフェニル) エチルスズ、4-ターシャリーブ トキシフェニルトリー n - プロピルスズ、ジ(4 - ター シャリーブトキシフェニル) ジーn-プロピルスズ、ト リ(4-ターシャリーブトキシフェニル) nープロピル スズ、4-ターシャリーブトキシフェニルトリーi-プ ロピルスズ、ジ(4 - ターシャリーブトキシフェニル) ジーi-プロピルスズ、トリ(4-ターシャリープトキ シフェニル) i-プロピルスズ、4-ターシャリープト キシフェニルトリーn-プチルスズ、ジ(4-ターシャ リーブトキシフェニル) ジーnープチルスズ、トリ(4 ーターシャリープトキシフェニル) nープチルスズ、4 - ターシャリープトキシフェニルトリー i - プチルス ズ、ジ(4-ターシャリーブトキシフェニル)ジーi-ブチルスズ、トリ(4-ターシャリープトキシフェニ ル) i-ブチルスズ、4-ターシャリーブトキシフェニ ルトリーsec-ブチルスズ、ジ(4-ターシャリーブ トキシフェニル)ジーsec-ブチルスズ、トリ(4-ターシャリープトキシフェニル)sec-ブチルスズ、 テトラ (4-ターシャリープトキシフェニル) メチルス ズ、4-ターシャリープトキシフェニルトリーtert ブチルスズ、ジ(4-ターシャリープトキシフェニ ル) ジー t e r t - ブチルスズ、トリ(4 - ターシャリ ープトキシフェニル) tert-ブチルスズ等を挙げる ことができる。

【0033】上記一般式(2)で示される4-ターシャリープトキシフェニル金属化合物の製造方法は特に限定するものではないが、例えば、下記一般式(8)

[0034]

[0035] (式中、Zは塩素原子、臭素原子又は沃素原子を表す。) で示されるマグネシウム化合物、又は下記構造式(9)

[0037]で示されるリチウム化合物を、対応する亜鉛化合物、ホウ素化合物、ケイ素化合物又は錫化合物と反応させることによって調製することができる。本発明の方法によれば、従来、-78 \mathbb{C} 程度の極低温で行わなければならなかったアリルホウ素化合物の調製が、-3 0 \mathbb{C} 以上、さらには実施例で表すが如く 0 \mathbb{C} 以上の温度で可能になる。

[0038] 本発明の方法において、上記一般式(3)で示される4-置換ペンゾニトリルとしては、4-クロロペンゾニトリル、4-ブロモベンゾニトリル、4-ヨ-ドベンゾニトリル、4-シアノフェニルトリフレートが挙げられる。

【0039】本発明の方法において、クロスカップリング反応の際に用いられるPd 触媒、Ni 触媒又はPd-Ni バイメタル触媒としては、特に限定するものではないが、例えば、下記一般式(10)

 $L^{1}_{f} P d X^{5}_{g}$ (式中、fは0~6の整数、gはPdの価数に相当する 数であり、Pdの価数は零価、一価又は二価である。X 5はハロゲン原子、水素原子、炭素数1~20の炭化水 素基、カルボン酸残基又はケトン残基であり、各々同一 であっても異なっていても良い。'L¹は、有機ホスフィ ン、有機ホスファイト、有機アルシン、有機アミン、有 機二トリル、有機イソシアニド、オレフィン、ジエン又 はカルポニルであり、各々同一であっても異なっていて も良く、さらにこれらは架橋されていても良い。) で示 される化合物、例えば、トリス(ジベンジリデンアセト ン) ニパラジウム(0)、ヘキサキス(2,6-キシリ ルイソシアニド) 三パラジウム (0)、カルボニルトリ ス(トリフェニルホスフィン)パラジウム、トリス(カ ルポニル) トリス (トリーtert. ープチルホスフィ ン) 三パラジウム(0)、(エチレン)ピス(トリフェ ニルホスフィン) パラジウム(0)、(フマル酸ジメチ ル) ビス (トリフェニルホスフィン) パラジウム

(0)、(メタクリル酸メチル) ビス (メチルジフェニルホスフィン) パラジウム (0)、テトラキス (トリエチルホスフィト) パラジウム (0)、テトラキス (トリフェニルホスフィン) パラジウム (0)、テトラキス (トリフェニルホスフィン) パラジウム (0)、テトラキス (トリシクロヘキシル) パラジウム (0)、テトラキス (トリーカーブチルホスフィン) パラジウム (0)、テトラキス (トリエチルホスフィン) パラジウム (0)、テトラキス (ジーtert.ーブチルカスフィン) パラジウム (0)、ビス (トリシクロヘキシル) パラジウム (0)、ビス (トリーカーブチルホスフィン) パラジウム

(0)、ビス(トリエチルホスフィン)パラジウム
(0)、ビス(ジーtert. - ブチルフェニルホスフィン)パラジウム(0)、テトラキス(トリフェニルアルシン)パラジウム(0)、ビス(シクロオクタジエン)パラジウム(0)、ジクロロビス[ビス(ジメチルホスフィノ)メタン]ニパラジウム(1)、ジブロモビス[ビス(ジメチルホスフィノ)メタン]ニパラジウム(1)、ジョードビス[ビス(ジメチルホスフィノ)メタン]ニパラジウム(1)、ジカロロビス(トリフェニ

ルホスフィン) パラジウム (II) 、ブロモビス (トリ フェニルホスフィン) パラジウム(II)、ジヨードビ ス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(II)、ジ クロロ [1, 2-ピス'(ジフェニルホスフィノ) エタ ン] パラジウム (1 1) 、ジブロモ [1 , 2 - ビス (ジ フェニルホスフィノ) エタン] パラジウム(Il)、ジ ヨード [1, 2ーピス (ジフェニルホスフィノ) エタ ン] パラジウム (II) 、ジクロロ [1, 3-ビス(ジ フェニルホスフィノ) プロパン] パラジウム(11)、 ジブロモ [1, 3-ビス (ジフェニルホスフィノ) プロ パン] パラジウム (II) 、ジヨード [1, 3ーピス (ジフェニルホスフィノ) プロパン] パラジウム(! I)、ジクロロビス(トリーtーブチルホスフィン)パ ラジウム (II) 、ブロモビス(トリー t ープチルホス フィン) パラジウム (II) 、ジョードピス (トリー t ブチルホスフィン)パラジウム(II)、ジクロロ [1, 2-ビス (ジーt-ブチルホスフィノ) エタン] パラジウム(II)、ジプロモ [1, 2-ビス(ジーt ブチルホスフィノ)エタン]パラジウム(II)、ジ ヨード [1, 2-ピス (ジーtーブチルホスフィノ) エ タン] パラジウム (II)、ジクロロ[1,3-ビス (ジーt-ブチルホスフィノ) プロパン] パラジウム (II)、ジブロモ[1,3-ビス(ジーt-ブチルホ スフィノ) プロパン] パラジウム(II)、ジヨード [1, 3-ビス(ジーt-ブチルホスフィノ)プロパ ン] パラジウム(II)、ジクロロピス(トリシクロへ **キシルホスフィン)パラジウム(II)、ジブロモビス (トリシクロヘキシルホスフィン) パラジウム(I** I)、ジョードピス(トリシクロヘキシルホスフィン) パラジウム (II)、ジクロロ [1, 2-ビス(ジシク ロヘキシルホスフィノ) エタン] パラジウム(I I)、 ジブロモ [1, 2-ビス (ジシクロヘキシルホスフィ ノ) エタン] パラジウム (II)、ジヨード [1, 2-ピス (ジシクロヘキシルホスフィノ) エタン] パラジウ ム (II)、ジクロロ[1,3-ビス(ジシクロヘキシ ルホスフィノ) プロパン] パラジウム(II)、ジブロ モ [1, 3-ビス(ジシクロヘキシルホスフィノ)プロ・ パン] パラジウム (II) 、ジョード [1, 3-ビス (ジシクロヘキシルホスフィノ) プロパン] パラジウム (11)、ジクロロビス(トリメチルホスフィン)パラ ジウム (I I) 、ジブロモピス (トリメチルホスフィ ン) パラジウム (II)、ジョードピス (トリメチルホ スフィン) パラジウム (II) 、ジクロロビス (トリエ チルホスフィン) パラジウム (II)、ジプロモビス (トリエチルホスフィン) パラジウム(II)、ジョー ドビス (トリエチルホスフィン) パラジウム (II)、 ジクロロビス (トリiープロビルホスフィン) パラジウ ム (II)、ジブロモビス(トリi-プロピルホスフィ ン) パラジウム(II)、ジョードビス(トリi-プロ ピルホスフィン) パラジウム (II)、ジクロロビス

(トリn-ブチルホスフィン) パラジウム(11)、ジ ブロモビス (トリn-ブチルホスフィン) パラジウム (II)、ジョードビス(トリnーブチルホスフィン) パラジウム (11)、ジクロロビス(メチルジフェニル ホスフィン) パラジウム(II)、ジブロモビス(メチ ルジフェニルホスフィン)パラジウム(II)、ジョー ドビス (メチルジフェニルホスフィン) パラジウム (I I)、ジクロロビス(ジメチルフェニルホスフィン)パ ラジウム (1 1) 、ジブロモビス (ジメチルフェニルホ スフィン) パラジウム (II)、ジョードピス (ジメチ 10 ルフェニルホスフィン) パラジウム (II)、クロロ (フェニル) ビス (トリフェニルホスフィン) パラジウ ム (II)、プロモ (フェニル) ピス (トリフェニルホ スフィン) パラジウム (II)、ヨード (フェニル) ピ ス (トリフェニルホスフィン) パラジウム (II)、ジ メチルピス (トリメチルホスフィン) パラジウム (I I) 、テトラメチレンピス (トリフェニルホスフィン) パラジウム(II)、酢酸パラジウム(II)、塩化パ ラジウム(11)、パラジウムカーポン等を挙げること ができ、これらの二種以上の混合物及び複核錯体の使用 20 も本発明の範囲に含まれる。

【0040】また、下記一般式(11) L²_b N i X⁶_i (11)

(式中、hは0~6の整数、iはNiの価数に相当する 数であり、Niの価数は零価、一価又は二価である。X 6は、ハロゲン原子、水素原子、炭素数1~20の炭化 水素基であり、同一であっても異なっても良い。L 2は、置換ホスフィン配位子, カルボニル配位子, アミ ン配位子であり、同一であっても異なっても良く、置換 ホスフィン配位子の場合、架橋されていても良い。)で 30 示される有機ニッケル錯体、例えば、トリカルボニル (トリフェニルホスフィンニッケル(0)、ジカルボニ ルピス(トリフェニルホスフィンニッケル(0), テト ラキス (トリフェニルホスフィン) ニッケル (0)、ニ 窒素ピス [ピス (トリシクロヘキシルホスフィン) ニッ ケル(0)]、(エチレン)ピス(トリフェニルホスフ ィン) ニッケル(0)、ピス(シクロオクタジエン)ニ ッケル(0)、(シクロドデカトリエン)ニッケル (0)、塩化トリス(トリフェニルホスフィン)ニッケ ル(I)、臭化トリス(トリフェニルホスフィン)ニッ ケル(I)、沃化トリス(トリフェニルホスフィン)ニ ッケル(1)、二塩化ビス(トリフェニルホスフィン) ニッケル(II)、二臭化ピス(トリフェニルホスフィ ン) ニッケル (I I) 、二沃化ピス (トリフェニルホス フィン) ニッケル (II) 、二塩化 [1, 2-ビス (ジ フェニルホスフィノ) エタン] ニッケル (II) 、二臭 化[1,2-ビス(ジフェニルホスフィノ)エタン]ニ ッケル (11)、二沃化[1,2-ビス(ジフェニルホ スフィノ) エタン] ニッケル(11)、二塩化[1,3 - ビス (ジフェニルホスフィノ) プロパン] ニッケル

(II)、二臭化[1,3-ビス(ジフェニルホスフィ ノ)プロパン]ニッケル(II)、二沃化[1,3-ビ ス(ジフェニルホスフィノ)プロパン]ニッケル(I 1)、二塩化ピス(トリーt-プチルホスフィン)ニッ ケル(II)、二臭化ピス(トリーtープチルホスフィ ン) ニッケル (II) 、二沃化ピス (トリーtープチル ホスフィン) ニッケル(II)、二塩化[1,2-ビス (ジーtープチルホスフィノ) エタン] ニッケル(I I)、二臭化[1, 2-ビス(ジーt-ブチルホスフィ ノ) エタン] ニッケル (II) 、二沃化 [·1, 2-ビス (ジーt-ブチルホスフィノ) エタン] ニッケル(I I) 、二塩化 [1, 3-ビス (ジーt-ブチルホスフィ ノ)プロパン]ニッケル(II)、二臭化[1,3-ビ ス (ジーtーブチルホスフィノ) プロパン] ニッケル (1 I)、二沃化[1, 3-ビス(ジ-t-ブチルホス フィノ)プロパン]ニッケル(II)、二塩化[1,2 -ビス(ジシクロヘキシルホスフィノ)エタン]ニッケ ル(II)、二臭化[1,2-ピス(ジシクロヘキシル ホスフィノ) エタン] ニッケル (I I) 、二沃化 [1, 2-ビス(ジシクロヘキシルホスフィノ)エタン]ニッ ケル(II)、二塩化[1,3-ビス(ジシクロヘキシ ルホスフィノ) プロパン] ニッケル(II)、二臭化 [1, 3-ビス(ジシクロヘキシルホスフィノ)プロパ ン] ニッケル(II)、二沃化[1,3-ビス(ジシク ロヘキシルホスフィノ)プロパン]ニッケル(II)、 二塩化ビス(トリシクロヘキシルホスフィン)ニッケル (11)、二臭化ピス(トリシクロヘキシルホスフィ ン) ニッケル(II)、二沃化ビス(トリシクロヘキシ ルホスフィン)ニッケル(II)、二塩化ピス(トリメ チルホスフィン)ニッケル(II)、二臭化ピス(トリ メチルホスフィン)ニッケル(II)、二沃化ビス(ト リメチルホスフィン)ニッケル(II)、二塩化ビス (トリエチルホスフィン) ニッケル (II)、二臭化ビ ス(トリエチルホスフィン)ニッケル(II)、二沃化 ピス(トリエチルホスフィン)ニッケル(II)、二塩 化ビス (トリi-プロピルホスフィン) ニッケル (I I)、二臭化ビス(トリi-プロピルホスフィン)ニッ ケル(II)、二沃化ピス(トリi-プロピルホスフィ ン) ニッケル(II)、二塩化ピス(トリn-プチルホ スフィン) ニッケル(II)、二臭化ビス(トリn-ブ チルホスフィン)ニッケル(II)、二沃化ピス(トリ n-ブチルホスフィン) ニッケル (II) 、二塩化ビス (メチルジフェニルホスフィン) ニッケル (II)、ニ 臭化ビス (メチルジフェニルホスフィン) ニッケル (I 1)、二沃化ビス(メチルジフェニルホスフィン)ニッ ケル(II)、二塩化ビス(ジメチルフェニルホスフィ ン) ニッケル (II) 、二臭化ビス (ジメチルフェニル ホスフィン)ニッケル(II)、二沃化ピス(ジメチル フェニルホスフィン)ニッケル(II)、塩化(フェニ ル) ピス (トリフェニルホスフィン) ニッケル (1

1)、臭化(フェニル)ピス(トリフェニルホスフィ ン) ニッケル (11)、沃化 (フェニル) ピス (トリフ ェニルホスフィン)ニッケル(II)、ジメチルビス (トリメチルホスフィン) ニッケル(11)、テトラメ **チレンピス(トリフェニルホスフィン)ニッケル(I** 1)、塩化(シクロペンタジエニル)(トリフェニルホ スフィン) ニッケル (II) 、メチル (シクロペンタジ **エニル)(トリフェニルホスフィン)ニッケル(I** 1)、塩化(ヒドリド)ピス(トリシクロヘキシルホス フィン) ニッケル (II)、二塩化 (2, 2'-ビピリ 10 ジル) ニッケル (II)、二臭化(2,2'-ビピリジ ル) ニッケル(II)、二跃化(2, 2'-ビピリジ ル) ニッケル (ΙΙ) 、ジエチル (2, 2'-ビピリジ ル) ニッケル (11) 等を挙げることができ、これらの 二種以上の混合物及び二臭化ビス [2-(エトキシカル ボニル) アリル] ニニッケル塩の如き、複核錯体の使用 も本発明の範囲に含まれる。

【0041】さらに、上記パラジウム化合物とニッケル 化合物を混合したもの、錯体化させたもの、及び粘土鉱 物等の担体に担持させたものを用いることも本発明の範 20 囲に含まれる。

【0042】上記一般式(2)で示される4-ターシャ リーブトキシフェニル金属化合物と上記一般式(3)で 示される4-置換ベンゾニトリル化合物をクロスカップ リング反応させる際の反応条件は、特に限定するもので はないが、窒素、アルゴン等の不活性ガス雰囲気下又は 大気下条件で、有機反応及び錯体合成で一般的な溶媒、 例えば、n-ペンタン、i-ペンタン、n-ヘキサン、 n ー デカン、ベンゼン、トルエン、アセトン、ジエチル エーテル、ジイソプロピルエーテル、n-ブチルメチル 30 エーテル、t-ブチルメチルエーテル、ジ-n-ブチル エーテル、テトラヒトロフラン、ジオキサン、N-メチ ルピロリドン、N, Nージメチルホルムアミド、シメチ ルスルホキシド、トリエチルアミン、ヘキサメチルリン 酸トリアミド等の溶媒中で、-85~200℃、好まし くは、-50~150℃の温度範囲で行うことができ る。また、上述した溶媒を混合した系を用いることもで

【0043】クロスカップリング反応の際に使用する触媒量は、特に限定されるものではないが、上記一般式(2)で示される4ーターシャリープトキシフェニル金属化合物1molに対し、パラジウム及び/又はニッケルが0.0001~1molとなるような範囲で使用することが好ましく、特に好ましくは、0.001~0.1molの範囲である。

【0044】本発明の方法において、上記一般式(2)で示される4-ターシャリーブトキシフェニル金属化合物が4-ターシャリーブトキシフェニルホウ素化合物である場合、触媒成分としてパラジウム及び/又はニッケル触媒に加えて塩基性化合物を用い、そして反応容媒と50

して水、アルコール類等の活性水素を有する極性溶媒を加えることが好ましい。この場合、目的物である顕著な 4ーターシャリープトキシー4'ーシアノピフェニルの 収率向上が見られる場合がある。使用する塩基性化合物 としては、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等の水酸化物、炭酸セシウム・サーリウム、炭酸タリウム、炭酸セシウムキーシー 大きな 大・リウムー は e r t . ーブトキシドのカルボン酸塩、ド・ナトリウム、酢酸カリウム等のが酸塩、ゲ・ナトリウムー は e r t . ーブトキシドのアルコキシド化合物、 す と r t . ーブトキシド等のアルコキシド化合物、 す と r t . ーブトキシド等のアルコキシド化合物、 す と r t . ーブトキシドのカルボン酸塩、 トリウム、酢酸カリウム等のカルボン酸塩、 トリウム、酢酸カリウム等のカルボン酸塩、 トリウム、酢酸カリウム等のカルボン酸塩、 ま と r t . ーズトリウム、酢酸カリウム等のカルボン酸塩、 r t e r t . ーズトリウム、酢酸カリウム等のカルボン酸塩、 r t e r t . ーズトリウム、酢酸カリウム等のカルボン酸塩、 r t e r t . ーズトリウム等のカルボン酸塩、 r t e r t . ーズトリウム、 r t e r t . ーズトリウム・ r t e r t

【0045】本発明の方法において、上記一般式(2)で示される4-ターシャリープトキシフェニル金属化合物、上記一般式(3)で示される4-置換ベンゾニトリル、及び触媒系の反応系への投入の条件は特に限定されないが、4-ターシャリープトキシフェニル金属化合物に触媒系を投入し、その後、4-置換ベンゾニトリルを滴下する方法、4-ターシャリープトキシフェニル金属化合物に予め触媒系と4ー置換ベンゾニトリルを溶媒で希釈混合したものを滴下する方法、溶媒で4-ターシャリープトキシフェニル金属化合物と4ー置換ベンゾニトリルを混合希釈したものに触媒系を投入し、クロスカップリング反応を開始させる方法等の如何なる投入混合形態をも使用できる。

【0046】そして、本発明の方法によって得られた4-ターシャリープトキシー4'ーシアノビフェニルは、アセトン等の良溶媒に溶解させたのち、塩酸、硫酸等の酸を触媒として脱プチル化することにより、4-ヒドロキシー4'ーシアノビフェニルとすることができる。【0047】

【実施例】以下に実施例を表すが、本発明は、これらの 実施例によって何ら限定されるものではない。

【0048】実施例1

(有機マグネシウム化合物の合成)窒素雰囲気下、還流 冷却器、滴下濾斗、提拌装置を備えた500mlのフラスコに、マグネシウムの21.4g(0.880mol)とテトラヒドロフラン69.2g(0.960mol)を仕込み、提拌開始後、これに滴下濾斗より、4-ターシャリーブトキシクロロベンゼン149.2g(0.800mol)とエチルブロマイド4.36g(0.0400mol)をテトラヒドロフラン138.5g(1.92mol)で希釈した溶液を、テトラヒドロフラン還流条件下に、2時間かけて滴下し、引き続き、同還流条件下で4時間提拌し、4-ターシャリーブトキシフェニルマグネシウムクロリドのテトラヒドロフラン溶液を得た。

【0049】(有機亜鉛化合物の合成)窒素気流下20

0mlのシュレンク管に、上記で調製した4-ターシャリーブトキシフェニルマグネシウムクロリドのテトラヒドロフラン溶液45.0mmolを取り、マグネチックスターラにより攪拌しつつ、これにテトラメチルエチレンジアミン1.57g(13.5mmol)を加えた後、滴下濾斗より、塩化亜鉛6.13g(45.0mmol)をテトラヒドロフラン30mlに溶解させた溶液を室温にて30分間で滴下し、更に1時間攪拌した。【0050】(クロスカップリング反応)窒素気流下、調製した4-ターシャリーブトキシフェニル塩化亜鉛をオイルバスで55℃とし、これにジクロロビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム0.316g(0.45

0mmol)を添加し、滴下濾斗より、4-プロモベン

ゾニトリル8. 19g(45.0mmol)をテトラヒ

ドロフラン30mlに溶解させた溶液を同温度にて30分間で滴下した。滴下終了後、更に同温度で1時間攪拌した。反応終了の後、1Nの塩酸水溶液を投入し、反応を停止させ、トルエンとジエチルエーテル混合溶媒で目的物である4-9-シャリープトキシー4'-シアノピフェニルを抽出した。得られた溶液を硫酸マグネシウムによる乾燥の後、生成した<math>4-9-シャリープトキシー4'-シアノピフェニルをガスクロマトグラフ内部標法により定量したところ、<math>8.32g(33.1mo1)であり、これは、収率73.6%に相当した。結果を表1に表す。

【0051】 【表1】

	(4-BuOPh) MX	0-0合成反応	クロスカップリング・反	4-"BuOPhPhCN	
	化合物	反応温度 (°C)	触媒	反応温度 (℃)	収率 (%)
実施例1	4-BuOPhZnCl	室温	PdCl ₂ (PPh ₃) ₂	55	73.6
実施例2	4-1BuOPhZnBr	室温	PdCl ₂ (PPh ₃) ₂	55	74.9
実施例3	4-'BuOPhZnBr	室温	PdGl ₂ (PPh ₃) ₂	室温	86.7
実施例4	4-BuOPhZnl	室温	PdGl ₂ (PPh ₃) ₂	55	82.2
実施例5	(4-'BuOPh),Zn	. 5	PdCl ₂ (PPh ₃) ₂	55	99.2
比較例1	4-BuOPhMgCl	-	PdGl ₂ (PPh ₃) ₂	55	0
実施例6	4-1BuOPhZnCI	室温	Ni(PPh ₃) ₄	55	51.5
実施例7	4-18uOPhZnBr	室温	Pd(OAc) ₂	55	35.1
実施例8	4- ^t BuOPhZnBr	5	Pd(OAc) ₂ /4P ^t Bu ₃	室温	85.8
実施例9	(4- ^t BuOPh),Zn	5	Pd(OAc) ₂ /2P(OEt) ₃ /6 BuLi	遠流	79.5
実施例10	4-1BuOPhB(OH)	-78	Pd(PPh ₃) ₄	遠流	92.2
実施例11	4-1BuOPhB(OH)2	-78	Pd/C	遵流	7,0.2
実施例12	4-1BuOPhB(OMe) ₂	. 3	Pd(PPh ₃) ₄	遺流	99.5
比較例2	4-1BuOPhB(OMe) ₂	50	Pd(PPh ₉) ₄	遠流	41.0
実施例13	4-1BuOPhB(OMe) ₂	3	PdCl ₂ (PPh ₃) ₂	遠流	87.1
実施例14	4-1BuOPhB(OMe) ₂	3	Pd(OAc) ₂	達流	93.6
実施例15	(4-¹BuOPh) ₃ B	3	Pd(OAc) ₂	遠流	86.4
実施例16	4-*BuOPhBEt ₂	3	Pd(OAc) ₂	遠流	86.2

【0052】(4-ターシャリープトキシー4'ーシアノビフェニルの同定)上記の4-ターシャリープトキシー4'ーシアノビフェニルの溶液からエバポレータにより、溶媒であるトルエンとジエチルエーテルを留去させ、得られた固体をヘキサン(70%)とアセトン(30%)混合溶媒系より再結晶させた。得られた4-ターシャリープトキシー4'ーシアノビフェニル再結晶物は、白色固体であり、ガスクロマトグラフにより純度99%であることが確認された。

【0053】更に、この4-ターシャリーブトキシー4'-シアノビフェニル再結晶物の融点及びスペクトルデータを採取したところ以下のとおりであった。

[0054] 融点=113℃、GC-MS測定;m/z (Max) = 251

元素分析C₁₇ H₁₇ NO wt%;

Found (C81. 5, H6. 9, N5. 4. O6. 2).

Calcd (C81. 2, H6. 8, N5. 6, O6. 4)

¹H-NMR; 1. 4 l p pm (s, 9H), 7. 1 0 p pm (d, 2H), 7. 5 2 p pm (d, 2H), 7. 6 7 p pm (m, 4H)

13 C-NMR; 29. 4 ppm (CH₃), 79. 5 p

pm (C), 110. 9ppm (C), 119. 5ppm (CN), 124. 8ppm (2CH), 127. 8ppm (2CH), 127. 8ppm (2CH), 128. 2ppm (2CH), 133. 0ppm (2CH), 135. 0ppm (C), 145. 7ppm (C), 156. 7ppm (C)
IR (cm-1); 3058, 2982, 2935, 2230 (CN), 1601, 1493, 1368, 1248, 1183, 897, 833, 713, 553
実施例2

実施例1の有機亜鉛化合物の合成において、塩化亜鉛 6.13g(45.0mmol)に変えて臭化亜鉛1 0.1g(45.0mmol)としたこと以外は、実施例1と同様に4-9-シャリープトキシー4, -シアノビフェニルの合成を行った。結果は、収率74.9%であった。結果を表1にあわせて表す。

[0055] 実施例3

実施例1の有機亜鉛化合物の合成において、塩化亜鉛6.13g(45.0mmol)に変えて臭化亜鉛10.1g(45.0mmol)としたこと、及び実施例1のクロスカップリング反応において4ープロモベンゾニトリル溶液の滴下温度及び反応温度の55℃を室温に、その反応時間を1時間から23時間としたこと以外は、実施例1と同様に4ーターシャリーブトキシー4、ーシアノビフェニルの合成を行った。結果は、収率86.7%であった。結果を表1にあわせて表す。【0056】実施例4

実施例1の有機亜鉛化合物の合成において、塩化亜鉛6.13g(45.0mmol)に変えて沃化亜鉛14.4g(45.0mmol)としたこと以外は、実施例1と同様に4-ターシャリープトキシー4'ーシアノピフェニルの合成を行った。結果は、収率82.2%であった。結果を表1にあわせて表す。

[0057] 実施例5

実施例1の有機亜鉛化合物の合成おいて、塩化亜鉛6. 13g(45.0 mmol)に変えて沃化亜鉛8. 62g(27.0 mmol)としたこと及びその溶液を滴下する際の内温を5 Cに維持したこと以外は、実施例1 E 同様に4-9- シャリープトキシー4 - シアノビフェニルの合成を行った。結果は、収率99.2 % C であった。結果を表1にあわせて示す。

【0058】比較例1

実施例1の有機亜鉛化合物の合成において、塩化亜鉛 6.13g(45.0mmol)を加えないこと、すなわち、有機亜鉛化合物を用いずに4-ターシャリープトキジフェニルマグネシウムクロリドをそのまま用いたこと以外は、実施例1と同様に反応を行ったが、4-ターシャリープトキシー4'ーシアノピフェニルの生成は確認されなっかた。結果を表1にあわせて表す。

【0059】実施例6

実施例1のクロスカップリング反応において、ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム0.316g(0.450mmol)に変えて、テトラキス(トルフェニルホスフィン)ニッケル0.499g(0.450mmol)としたこと以外は、実施例1と同様に4~ターシャリープトキシー4'ーシアノビフェニルの合成を行った。結果は、収率51.5%であった。結果を表1にあわせて表す。

【0060】実施例7

実施例1の有機亜鉛化合物の合成において、塩化亜鉛6.13g(45.0mmol)に変えて臭化亜鉛10.1g(45.0mmol)としたこと、及び実施例1のクロスカップリング反応においてジクロロビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム0.316g(0.450mmol)に変えて、酢酸パラジウム0.101g(0.450mmol)としたこと以外は、実施例1

18

と同様に4-9-シャリープトキシー4 ーシアノピフェニルの合成を行った。結果は、収率3.5 1%であった。結果を表1にあわせて表す。

【0061】実施例8

実施例1の有機亜鉛化合物の合成において、塩化亜鉛6.13g(45.0mmol)に変えて臭化亜鉛10.1g(45.0mmol)としたこと及びその溶液を滴下する際の内温を5℃に維持したこと、更に実施例1のクロスカップリング反応においてジクロロビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム0.316g(0.450mmol)に変えて、酢酸パラジウム0.101g(0.450mmol)とトリータシャリーブチルホスフィン0.364g(1.80mmol)としたこと以外は、実施例1と同様に4-ターシャリーブトキシー4'-シアノビフェニルの合成を行った。結果は、収率85.8%であった。結果を表1にあわせて示す。

【0062】実施例9

(クロスカップリング反応用触媒の調製) 100mlのシュレンク管にトルエン10ml、テトラヒドロフラン10ml及び亜燐酸トリエチル0.105g(0.90mmol)を仕込み、これに攪拌しつつ、1.48mol 1/L 0/L 0

【0063】(有機亜鉛化合物の合成)実施例1の有機 亜鉛化合物の合成において、塩化亜鉛6.13g(4 5.0mmol)に変えて臭化亜鉛6.08g(27. 0mmol)としたこと及びその溶液を滴下する際の内 温を5℃に維持したこと以外は、実施例1と同様に有機 亜鉛化合物を合成した。

【0064】 (クロスカップリング反応) 実施例1のクロスカップリング反応においてジクロロビス (トリフェニルホスフィン) バラジウム0.316g(0.450mmol) に変えて、上記のクロスカップリング用触媒を用いたことしたこと以外は、実施例1と同様に4-ターシャリーブトキシー4'ーシアノビフェニルの合成を行った。結果は、収率79.5%であった。結果を表1にあわせて示す。

【0065】実施例10

(有機マグネシウム化合物の合成) 実施例1の有機マグネシウム化合物の合成と全く同様に4-ターシャリープトキシフェニルマグネシウムクロリドを合成し、以下の反応に用いた。

【0066】 (有機ホウ素化合物の合成) 窒素気流下200mlのシュレンク管に、上記で調製した4-ターシャリープトキシフェニルマグネシウムクロリドのテトラヒドロフラン溶液60.0mmolを取り、マグネチックスターラにより攪拌しつつ、ドライアイスメタノール

浴により、-78℃まで冷却した。滴下遮斗より、トリメトキシホウ素 5.92g(57.0mmol)をジエチルエーテル20mlに希釈した溶液を-78℃、1時間の条件で滴下した。滴下終了の後、5時間で0℃まで昇温し、0℃にて1時間攪拌した。

【0067】1 Nの塩酸水溶液で反応を停止した後、ジエチルエーテルで目的物であるジヒドロキシ(ターシャリーブトキシフェニル)ホウ素を抽出し、エパポレータでジエチルエーテルを留去して、ジヒドロキシ(ターシャリーブトキシフェニル)ホウ素の白色固体を得た。この白色固体を、ヘキサンとアセトンとの混合溶媒より再結晶し、ジヒドロキシ(ターシャリーブトキシフェニル)ホウ素8.82g(45.5mmol)を得た。収率は75.9%に相当する。

【0068】(クロスカップリング反応) 還流冷却器を 備えた200mlのシュレンク管に、マグネチックスタ - ラで攪拌しつつ、上記で調製した調製したジヒドロキ シ (ターシャリープトキシフェニル) ホウ素1. 94g (10.0mmol)、4-プロモベンゾニトリル1. 82g(10.0mmol)、テトラヒドロフラン20 20 ml、エタノール30ml、炭酸ナトリウム2.12g (20.0mmol)を20mlの純水に溶解させた水 溶液を混合し、これにテトラキス(トリフェニルホスフ ィン) パラジウム 0. 116g(0. 100mmol) を添加した後、オイルバスにて還流条件下、2時間攪拌 した。反応終了の後、1 Nの塩酸水溶液を投入し、反応 を停止させ、トルエンとジエチルエーテル混合溶媒で目 的物である4-ターシャリーブトキシー4'-シアノビ フェニルを抽出した。得られた溶液を硫酸マグネシウム による乾燥の後、生成した4-ターシャリーブトキシー 30 4'ーシアノビフェニルをガスクロマトグラフ内部標準 法により定量したところ、2.31g(9.22mo 1) であり、これは、収率92.2%に相当した。結果 を表1にあわせて表す。

[0069] 実施例11

実施例10のクロスカップリング反応において、テトラキス (トリフェニルホスフィン) パラジウム0.116g (0.100mmol) に変えて、パラジウムカーボン (Pd10.0wt%) 0.106g (Pd0.100mmol) としたこと以外は、実施例7と同様に4-40ターシャリーブトキシー4'ーシアノビフェニルの合成を行った。結果は、収率70.2%であった。結果を表1にあわせて表す。

【0070】実施例12

(有機マグネシウム化合物の合成) 実施例1の有機マグネシウム化合物の合成と全く同様に4-ターシャリーブトキシフェニルマグネシウムクロリドを合成し、以下の反応に用いた。

[0071] (有機ホウ素化合物の合成) 窒素雰囲気 下、還流冷却器、滴下濾斗、攪拌装置を備えた300m so 1のフラスコに、上記で調製した4-ターシャリープトキシフェニルマグネシウムクロリドのテトラヒドロフラン溶液60.0mmolを取り、提拌しつつ、氷浴により、3℃まで冷却した。滴下濾斗より、トリメトキシホウ素6.23g(60.0mmol)をテトラヒドロフラン50mlに希釈した溶液を3℃、2時間の条件で滴下した。滴下終了の後、室温にて1時間攪拌した。こうして合成したジメトキシ(ターシャリープトキシフェニル)ホウ素を次のクロスカップリング反応にそのまま用いた。

[0072] (クロスカップリング反応) 上記のジメトキシ (ターシャリープトキシフェニル) ホウ素のテトラヒドロフラン溶液に炭酸ナトリウム 6.36(60.0 mmol)を50mlに希釈した水溶液を室温にて加え、10分間攪拌した。

[0073] これに4ープロモベンゾニトリル10.9g(60.0mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム0.693g(0.600mmol)、エタノール50mlを添加し、オイルバスにより昇温して、還流条件下で2時間攪拌した。反応終了の後、1Nの塩酸水溶液を投入し、反応を停止させ、トルエンとジエチルエーテル混合溶媒で目的物である4ーターシャリーブトキシー4'ーシアノビフェニルを抽出した。得られた溶液を硫酸マグネシウムによる乾燥の後、生成した4ーターシャリーブトキシー4'ーシアノビフェニルをガスクロマトグラフ内部標準法により定量したところ、15.0g(59.7mol)であり、これは、収率99.5%に相当した。結果を表1にあわせて表す。

【0074】比較例2

実施例9の有機ホウ素化合物の合成において、反応温度 3℃に変えて、50℃としたこと以外は、実施例9と同 様に4-ターシャリーブトキシー4'-シアノビフェニ ルの合成を行った。結果は、収率41.0%であった。 結果を表1にあわせて表す。

【0075】実施例13

実施例12のクロスカップリング反応において、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム0.693g(0.600mmol)に変えて、ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム0.421g(0.600mmol)としたこと以外は、実施例12と同様に4-9-シャリーブトキシー4' -シアノビフェニルの合成を行った。結果は、収率87.1%であった。結果を表1にあわせて表す。

【0076】実施例14

実施例 12のクロスカップリング反応において、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム 0.693 g 0.600 mm 0.1 に変えて、酢酸パラジウム 0.135 g 0.600 mm 0.1 としたこと以外は、実施例 12 と同様に 4-9- シャリープトキシー

4'-シアノビフェニルの合成を行った。結果は、収率 93.6%であった。結果を表1にあわせて表す。

【0077】実施例15

実施例12の有機ホウ素化合物の合成において、トリメトキシホウ素の添加量を6.23g(60.0mmol)から2.08g(20.0mmol)としたこと及び実施例12のクロスカップリング反応においてテトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム0.693g(0.600mmol)に変えて、酢酸パラジウム0.135g(0.600mmol)としたこととした 10こと以外は、実施例12と同様に4-ターシャリープトキシー4'ーシアノビフェニルの合成を行った。結果は、収率86.4%であった。結果を表1にあわせて示す。

【0078】実施例16

実施例12の有機ホウ素化合物の合成において、トリメトキシホウ素6.23g(60.0mmol)に変えて、ジエチルメトキシホウ素6.00g(60.0mmol)としたこと及び実施例12のクロスカップリング反応においてテトラキス(トリフェニルホスフィン)パ 20 ラジウム0.693g(0.600mmol)に変えて、酢酸パラジウム0.135g(0.600mmol)としたこと以外は、実施例12と同様に4-ターシャリーブトキシー4'ーシアノビフェニルの合成を行った。結果は、収率86.2%であった。結果を表1にあわせて示す。

【0079】 実施例17

(4-ヒドロキシ-4'-シアノビフェニルの合成) 還

流冷却器を備えた200mlのシュレンク管に、実施例 1で得た4-ターシャリーブトキシー4'-シアノビフ ェニルの再結晶5.02g(20.0mmol)を仕込 み、マグネチックスターラで提拌しつつ、アセトン10 0mlに溶解させた。このアセトン溶液に35.6wt %塩酸水溶液を1.50g添加し、50℃で8時間攪拌 させた。反応終了の後、反応液を純水300ml中に加 え、目的物である4-ヒドロキシー4'-シアノビフェ 二ルを析出させた。析出した固体を濾別し、純水で洗浄 し後、150℃で12時間乾燥させた。得られた4-ヒ ドロキシー4'-シアノビフェニルは、3.64g(1 8. 6 mm o 1) であり、単離収率 9 3. 2%であっ た。また、その¹ H-NMR及び¹³ C-NMRスペクト ルは、ターシャリーブチルに由来するピークが完全に消 失し、公知の4-ヒドロキシー4'ーシアノピフェニル のピークパターンと完全に一致した。

[0080]

【発明の効果】本発明によれば、以下の顕著な効果が奏される。

【0081】すなわち、本発明の第一の効果としては、液晶中間体である4ーヒドロキシー4'ーシアノビフェニルや側鎖型液晶ポリマーのモノマーの原料として極めて有用な4ーターシャリーブトキシー4'ーシアノビフェニルを極めて高純度に提供できる。

【0082】また第二の効果としては、4-ターシャリープトキシー4'ーシアノビフェニルを合成するにあたり、極めて効率的で、経済的なクロスカップリング反応処方を提供できる。

フロントページの続き

FΙ

テーマコード(参考)

C 0 7 B 37/04

F

61/00

300